

Suporte De Cesto De Limpeza De Laboratório Em Ptfé Personalizado - Porta Wafer Resistente A Ácidos E Bases De Alta Pureza, Sem Contaminação De Baixo Ruído De Fundo Para Banhos Químicos

Número do item: PL-CP268



introdução

Descubra suportes de cesto de limpeza em PTFE personalizados de alta pureza desenvolvidos para semicondutores e análise de traços. Esses suportes resistentes a ácidos garantem lixiviação zero e níveis de fundo ultra-baixos, fornecendo desempenho confiável nos ambientes químicos mais exigentes para processos de limpeza laboratorial de precisão.

Saiba mais

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Limpeza de Wafer de Semicondutor	Fixação segura de wafers de silício durante processos de limpeza RCA ou corrosão com HF em ambientes de sala limpa.	Evita contaminação metálica e garante exposição química uniforme.
Análise de Metais Traço	Limpeza e lixiviação de vidrarias usadas para preparação de amostras ICP-OES e ICP-MS para atingir pureza no nível de ppt.	Elimina interferência de fundo do próprio material do recipiente.
Pesquisa em Baterias	Manuseio de materiais de ânodo e cátodo durante fases de imersão em eletrólito ou tratamento químico.	Resistência a solventes orgânicos agressivos e sais de lítio.
Esterilização Farmacêutica	Transporte de frascos de vidro ou componentes de precisão através de ciclos de esterilização de alta temperatura ou quimicamente agressivos.	Mantém a pureza e evita a adsorção superficial de ingredientes ativos.
Desengorduramento de Componentes Aeroespaciais	Fixação de peças de liga usinadas com precisão durante ciclos de limpeza profunda em desengordurantes químicos agressivos.	Durabilidade a longo prazo em reagentes de limpeza de força industrial.
Fabricação de Células Solares	Suporte a substratos fotovoltaicos durante processamento químico úmido e etapas de texturização.	Resistência a altas temperaturas e compatibilidade química com agentes corrosivos.
Preparação de Amostras Geológicas	Digestão e limpeza de amostras minerais usando ácido hidrofúrico concentrado para determinação elementar.	Manuseio seguro em ambientes ácidos perigosos sem degradação do recipiente.

Categoria de Especificação	Detalhes do Parâmetro para PL-CP268	Valores / Capacidades
Propriedades do Material	Material de Construção Principal	PTFE (Politetrafluoroetileno) Virgem de Alta Pureza
	Fundo de Elementos Traço	Ultra-Baixo (Adequado para análise no nível de PPT)
	Resistência Química	Universal (Exceto metais alcalinos fundidos/fluor)
	Absorção de Água	<0,01%
Dimensões Físicas	Configuração	Totalmente Personalizável de acordo com as Especificações do Cliente
	Opções de Tamanho	Projetos sob medida para wafers de 2", 4", 6", 8", 12" ou vidrarias personalizadas
	Recursos de Manuseio	Alças integradas opcionais, braços extensíveis ou tampas com trava

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Categoria de Especificação	Detalhes do Parâmetro para PL-CP268	Valores / Capacidades
Limites Térmicos	Temperatura Máxima de Operação	260°C (500°F)
	Temperatura Mínima de Operação	-200°C (-328°F)
Detalhes de Fabricação	Método de Fabricação	Usinagem CNC de Alta Precisão
	Rugosidade Superficial	Ra 0,4 - 0,8 µm (Padrão) / Opções polidas disponíveis
	Referência do Número do Item	PL-CP268